

期刊信息

篇名	Thermal stability, phase and interface uniformity of Ni-Silicide formed by Ni-Si solid-state reaction
语种	英文
撰写或编译	
作者	屈新萍,蒋玉龙,茹国平等
第一作者单位	
刊物名称	Thin Solid Films
页面	462-463, 146-150 (2004).
出版日期	2004年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	多层薄膜固相反应与Co-Ni系硅化物薄膜外延及应用研究